

高エネルギー物理学研究所 石川 哲也

# Applications of Extremely Collimated X-rays

Tetsuya Ishikawa

Photon Factory, National Laboratory for High Energy Physics

Collimated X-rays with less than 0.01 arcsec angular divergence was produced by using successive asymmetric diffractions at  $\lambda = 0.7$  A. Coherent length of this beam was directly measured from visibility of equal-thickness fringes, giving values of >20  $\mu$ m(transverse) and >41 $\mu$ m(longitudinal). Topographic image of dislocations with this beam revealed the fine structures which had not been observed before.

## 1. はじめに

シンクロトロン放射光が利用されるようになっ て以来、その高強度、指向性の良さ、偏光性及び 波長連続性等の特徴を活かして、VUVから硬 X 線領域の光を用いた種々の研究の進展にはめざま しいものがある。筆者は、高エネルギー物理学研 究所放射光実験施設(フォトン・ファクトリー) で、精密 X線光学実験ステーションを担当してい るが、この分野にとっても上記のシンクロトロン 放射光の諸特徴がもたらしたものは、おそらく他 の多くの分野と同様に、はかりしれないものがあ る。それに加えて、シンクロトロン放射光での実 験では、従来の X線源(特に大強度の回転対陰極 型)では大きな問題であった実験環境の温度変化 や、振動に悩まされることもなく、「気軽に」精 密実験を行なうことが可能になっている。

光源強度が増大すると、同じ実験であればデー タ収集時間が短縮され、場合によっては膨大なデ ータをかかえこむことになる。一方では、より弱 い相互作用の追求が可能となるし、また高分解能 を追求することもできる。ここでは、高分解能化 の一例として、1/100秒以下に平行化されたX線 束の作成と、そのようなX線束を用いた2つの応 用例、(a) X線可干渉長の測定<sup>1)</sup>及び(b) X 線ト ポグラフィへの応用2),を紹介する。

#### 平行X線束の作成

実験は、高エネルギー物理学研究所・放射光実 験施設の BL-15C で,水平多軸精密回折計<sup>3)</sup>を用 いて行なわれた。実験配置を図1に示すが、四結 晶配置の最初の3つが平行X線束を作るためのも のであり、最後の結晶が試料になっている。最初 の結晶 (C<sub>1</sub>) は, BL-15C に入ってくる白色放射 光X線を粗く分光するためのものであり、(111)Fz-シリコンが用いられている。白色X線照射による 熱的な不安定を除くために水冷された銅ブロック (H) に固定されている。この結晶で、  $\lambda = 0.70$  Å (aの場合), 0.72Å(bの場合)のX線を, 111対 称反射を用いて取り出している。単色化された X 線は, スリットにより巾 35 mm, 高さ 0.5 mm に 整形されて、第2の結晶 (C<sub>2</sub>) に入射する。第2 及び第3結晶は、Fz-シリコン単結晶から作られ たもので,非対称 220, 220 反射により,X線束を 試料位置に導く。これらの結晶の非対称因子

$$b = \frac{\sin (\theta_{B} - \alpha)}{\sin (\theta_{B} + \alpha)} , \qquad (1)$$
  

$$\theta_{B} : \quad \vec{\mathcal{I}} = \vec{\mathcal{I}} = \vec{\mathcal{I}} \vec{\mathcal{I$$



図1 実験配置(正面図)。C<sub>1</sub>: プリモノクロメーター結晶、(111)シリコン、111 対称反射。C<sub>2</sub>及びC<sub>3</sub>
 : コリメータ結晶、220非対称反射。S: 試料結晶、ラウエケース 220 対称反射。H: 水冷結晶台。
 P: 真写乾板。 D: 角度位置モニター用シンチレーション ディテクタ。

は (a) の場合 1/40, (b) の場合 1/36 となってい る。

試料 (S) に入射する X線束の角度拡がり、 $\triangle \theta$ 、 は第 2 結晶の非対称因子を  $b_2$ 、第 3 結晶の非対 称因子を  $b_3$ , Si 220 対称反射のイントリンシック な回折角度巾を $\omega$ s として

$$\triangle \theta = \sqrt{b}_2 \ b_3 \ \omega_s \ , \qquad (2)$$

となる<sup>4)</sup>。したがって△θは (a) では,イントリ ンシックな角度巾の 1/253,すなわち 0.008 秒, (b) では,1/216,すなわち 0.01 秒となっている。 試料では,220 対称反射(ラウエケース)を用い ているので,入射 X線束の平行性は,試料の回折 角度巾の 1/200 以下になっていることになる。

#### 3. X線可干渉長の測定<sup>1)</sup>

現在までの大抵のX線回折理論,実験では,可 干渉長の影響は殆んど考慮されていないが,実際 上X線束は,その波長拡がりや角度拡がりに対応 して時間的にも空間的にも有限な可干渉長をもつ。 ここで作られたような,非常に平行なX線束が, 通常より長い時間的・空間的可干渉長をもつこと は,当然予想されていたが,従来のX線源では直 接可干渉長を測定するには不十分な強度しか得ら れなかったために,実験的な検証は行なわれてい ない。 ところが、放射光を用いると、かなり無茶な単 色化・平行化を行なっても十分な強度を持つX線 束を取り出すことが可能となり、楔形試料の等厚 干渉縞のコントラストから、X線の可干渉距離を 見積ることができる様になった。

### 3.1 測定の原理

動力学的回折理論5-7)によれば、非常に単色、 平行化された入射 X線束によって,完全結晶でラ ウエケースの回折がおこっている時、結晶内での 波動場はほとんど平面波からなり,分散面上の非 常に小さな領域が励起される。分散面の上側の分 枝(1)と下側の分枝(2)に属する波動場のポインテ ィングベクトルは、分散面の法線方向を向き、ブ ラッグ条件が正確に満足されている場合以外には 異なる方向に向かう<sup>8) 9)</sup>(図2)。平面波入射の場 合の動力学的回折理論では,一般に入射X線は, 無限に広い波面と無限に長い波連をもつことが仮 定されていて、X線出射表面上の点PでのX線強 度は、2つの波動場の干渉の結果として与えられ る(図3)。分散面の分枝1に属する波動場は、入 射表面上の点AからS1に沿って伝播し、分枝2に 属する波動場は点 BからS<sub>2</sub>に沿って進む。

しかしながら,実際には波面は有限な巾しかもた ないし,波連も有限な長さしかもたない。したが って,入射表面上の点A,Bの間の距離がある臨 界値を越えると、 $S_1 \ge S_2$ に沿って伝播してきた 2 つの波動場は、P点でもはや干渉しえない。AB 間の距離 d は、対称反射の場合、結晶の厚さを t、  $S_1 \ge S_2$ のなす角を 2  $\Omega$  とすると

$$d = 2t \tan \Omega \tag{3}$$

で与えられる。Ωは、ブラッグ条件からのはずれ の関数として、吸収を無視した場合に

$$\tan \Omega = \frac{|W| \tan \theta_{\rm B}}{\sqrt{1+W^2}} \tag{4}$$

で与えられる。ここでWはブラッグ条件からのは ずれをあらわすパラメーターであり

$$W = \frac{2 \left( \theta_0 - \theta_B \right)}{\omega_S} \tag{5}$$

 $heta_{0}: 反射面への照射角$ 

として与えられる。

2つの波動場がP点で干渉しているか否かは、



 図 2 1つの偏光状態(今の場合σ-偏光)での分 散面。平面波の場合には、タイポイントA<sub>1</sub> とA<sub>2</sub>からの2つの波動場が干渉する。分枝 1及び2の波動場のポインティングベクト ルS<sub>1</sub>、S<sub>2</sub>は、各々の分枝の法線方向を向き 一般には異なる方向に向かう。 等厚干渉縞のビジビリティが判断基準となる。こ の等厚干渉縞を観察するために、試料として楔型 結晶を用いるわけである。分散面の分枝1,2が 異なる吸収を受けることによって、等厚干渉縞は ぼけるが、結晶のどこまでの厚さで等厚干渉縞が 観察できるかが、平行化されたX線の可干渉長の 「ものさし」になる。この方法では、時間的可干渉 長と空間的可干渉長を分離して測定することはで きないが、あるWの値で結晶の厚さ  $t_{limit}$  まで 等厚干渉縞が観測されたとすれば、時間的可干渉 長、dl (l は longitudinal の略)と、空間的可干 渉長 dt (t は transverse の略)は、次式で与えら れる長さよりも長いということが結論できる。

$$d_{l} = \frac{2 t_{limit} |W| \tan \theta_{B} \sin \theta_{B}}{\sqrt{1 + W^{2}}} , \quad (6)$$

$$d_{t} = \frac{2t_{\text{limit}} |W| \sin \theta_{\text{B}}}{\sqrt{1 + W^{2}}} \qquad , (7)$$

### 3.2 実験結果及び解析

試料結晶は前述したように楔形をしており、その形状を図4に示す。この試料を用いて、(A)W=



図3 X線出射表面上の点 Pでの干渉をおこす、分枝1と分枝2のX線束の光路

-2.39, (B) W=-1.13, (C) W=0, (D) W=1.07及
び(E) W=2.28 の5つの角度位置で、トポグラフ
を撮った。使用した原子核乾板は、Ilford L4, 50
µm 厚であり、露光時間はWによって変化するが、
リングのパラメタ 2.5 GeV, 150 mA で換算して
15分から 80分である。

図5に、(A)~(E)のW値での回折波中に観察 される等厚干渉縞を示す。ラウエケースでの平面 波入射X線に対する回折強度は、W及びtの関数 として、



図 4 試料結晶。Fz-シリコン・インゴットより 切り出し、メカノケミカル研磨により表面 処理。220 反射がトポグラフに使用された。

R<sub>L</sub>(W) = 
$$\frac{\sin^2(\pi t \sqrt{1 + W^2}/\triangle_0)}{1 + W^2}$$
 (8)  
: 吸収のない場合

として与えられる。この実験ではシンクロトロン 放射光を用いているので、 $\sigma$  — 偏光のみとなって おり、いわゆるフェーディングは観測されない。  $\triangle_0$ は、W = 0 のときの等厚干渉縞の間隔であり、 計算値は 36.51  $\mu$ m である。(8) 式から、ブラッ グ条件からはずれた時の等厚干渉縞の間隔は

$$\triangle W = \frac{\triangle_0}{\sqrt{1 + W^2}} \tag{9}$$

で与えられることがわかる。したがって図5の写 真で、|W|が小さい時には、フリンジ間隔は大き く、|W|が大きくなるにしたがって細かいフリン ジになる。

3. 1で予想した様に、ブラッグ条件からのはず れ、|W|が大きくなると、等厚干渉縞が観察しう る最大の厚さ、t<sub>limit</sub>,は小さくなる。各々のW の値で測定された t<sub>limit</sub>の値と、それらを(6) 式、(7)式に入れて計算した d<sub>l</sub>, d<sub>t</sub>の値を**表1**に まとめておく。もちろんこの程度の値は、X線モ ノクロメータの後方に細いスリットを入れて、そ の1km 程度後方で観測すれば得られる、が、現



図5 楔型試料での等厚干渉縞:入射条件Wは、(A)-2.39,(B)-113,(C)0,(D)1.07及び(E)2.28

表 1	時間的可干涉長	dı	と空間的可干渉長 d <sub>f</sub>
-----	---------	----	-------------------------

W	t <sub>limit</sub> (µm)	dl (µm)	d <sub>t</sub> (μm)
-2.39	640	220	41
-1.13	780	220	41
0.0	>1400	_	_
1.07	810	220	41
2.28	650	220	41

在の実験は、光源から 30m の地点で行なわれて おり、原理的には、更に光源点に近づいても同様 な可干渉長の長い X線束を得ることができる。ま た、異なるWの値での測定結果が、極めて良く一 致することは、フリンジのビジビリティが分枝 (1), (2) の吸収のちがいによるものではないことを示 している。

#### 4. X線トポグラフィへの応用<sup>2)</sup>

今まで、平面波 X線トポグラフィは、一枚の非 対称反射コリメータを用いて、試料結晶の回折角 度巾の 1/5~1/10 に平行化された入射 X線束を用 いて行なわれてきた<sup>10)→4</sup>。しかしながら、石田た ち<sup>14)</sup>による実験と計算の比較によれば、入射 X線 束を回折角度巾の 1/5 としても、角度拡がりの影 響によって格子欠陥像の細かい干渉パターンはぼ かされてしまう。また計算機実験の結果によると このぼけが目立たなくなるのは、入射 X線束を回 折角度巾の 1/100 以下にしなければならないこと がわかった。

したがって,2.で述べられた光学系を用いると 真の意味での平面波X線トポグラフィ実験を行な うことが可能となる。

#### 4.1 平行平板シリコン単結晶内の転位像

平面波X線トポグラフの最初の例として、厚さ 約330 µmになる様に、両面メカノケミカル研磨 で鏡面にした平行平板シリコン単結晶内の転位例 の例を紹介する。この実験は、1988 年3月に行な われたものであり、細かい解析はまだ済んでいな いが、従来この結晶配置による平面波 X線トポグ ラフにはみられなかったいくつかの特徴がある。

実際には、ブラッグ条件からのはずれ角、 $\triangle \omega$ が 0", ± 0.75", ± 1.50", ± 2.25" の7つの点でト ポグラフが撮られたが、紙数の関係からここでは その一部分のみを紹介することにしたい。個々の トポグラフ撮影の前に、入射条件を決めるために 回折強度曲線が測定された。この測定には、転位 列から離れた完全結晶部分からの回折X線が 1 mm × 1 mm のスリットで切りとられて用いられた。 この実験でも、3. と同様に、50  $\mu$ m膜厚の llford, L4 原子核乾板が用いられ、ストレージングの運 転条件 2.5 GeV, 250 mA で 15分 - 50分の露光時 間を要した。

平行平板結晶での回折強度曲線は、(8)式で結晶 の厚さtを一定としたものであり、振動的なプロ ファイルを持つ。したがって、|△ω| が小さい時 には、入射条件のほんの少しのちがいが、回折強 度の大きな差となって出てくる。露光中にも、原 子核乾板を透過してくるX線束を用いて、入射条 件のドリフトをチェックしているが、今の場合に はフィードバック系を使用しないで 0.01″以下の ドリフトに抑えられている。

図6に、回折強度曲線の計算値と実測値とを示 す。(8)式からわかる様に、結晶の厚さtの誤差 がプロファイルを大きく変化させる。計算では、 tをパラメータとしてプロファイル全体と、ピー ク間隔が実験値と合うものを探し、t=334 µmで 良い一致をみた。計算には、(8)式ではなく、吸 収を含む式を用い、入射波は完全な平面波と仮定 している。実験値は、ピーク間の谷が計算値ほど 深くないが、これは、(a)実際の入射波には、小 さいとはいえ有限な発散があること、及び後にみ る様に(b)転位列の歪場が非常に遠くまで及んで いること、の二つの理由によると考えられる。

図7に、△ω=-2.25″でのトポグラフを示す。 この写真の下方に十数本のほぼ平行な直線状の像 がみえるが、この1つ1つが転位である。これら



図6 平行平板結晶からの回折強度曲線: (A)t= 334 µm での計算値、(B) 実測値。縦軸は任意尺度で あるが、計算値と実測値のピーク強度が同じになる様に規格化してある。

の転位は、同じバーガーズベクトルを持つ刃状転 位であり、余分な格子面は全て結晶の片側にある。 このために転位列の近傍では、結晶のバックリン グがおこっており、1本1本の転位ごとに異なる 入射条件となっている。直線状の転位像の中に、 フリンジ構造が観られるが、この写真では、左側 の転位でのフリンジ間隔が右側の転位での間隔に くらべて短かくなっている。この間隔は、結晶内 部での等厚干渉縞の間隔、△w((9)式参照)に対 応しており、これから局所的な入射条件、すなわ ちWの値を決定することができる。右側にいくに 従って、ブラッグ条件に近くなっているが、ここ には、丁度ブラッグ条件を満足した像(W=0)は みられない。

このトポグラフには、転位像の他に試料全体に

広がったフリンジがみられる。このフリンジは、 転位と結晶表面との交点の近くから、湧き出して 他の交点で終っている。これは、以前楔型結晶で 等厚干渉縞の異常として観察されたもの<sup>12)</sup>が、入 射X線束の平行性を高めたことによって、平行平 板結晶でも観察されていると理解できる。ブラッ グ条件から離れた入射条件で、転位と結晶表面と の交点で湧き出すフリンジの数は、2本であり、 |g・b | と一致している。このフリンジ系は、 以前に結晶平面波X線トポグラフィで同じ試料を 観察した時にはみられなかったものであり、現在 解析が進められている。

## 5. おわりに

本稿では、1/100 秒以下に平行化された X線束



g = (220)

図7 △ω=-2.25″での平面波X線トポグラフ。 真写下方に十数本のほぼ平行な転位列の像 がみえる。これらの転位は、結晶表面に対 して、5°傾いて入っており、真写の上側で X線入射側の表面と交わり、下側で出射側 の表面と交わる。

の作成とその応用とを紹介したが、ここで作られ たような可干渉長の長いX線束を用いると、硬X 線領域でのホログラフィの可能性が展けてくる。 今の場合には、空間的な可干渉長は、0.1mmのオ -ダーであるが、現在得られている X線強度を考 えれば、フォトン・ファクトリーの普通のビーム ラインでも更に 1 ~ 2桁可干渉長の長い X線束を 作成し、実際に実験に用いることが可能であるし また現在建設中のマルチポールウィグフービーム ライン (BL-16) では、3~4桁のばすことも夢で はない。更に次世代リングでのアンジュレータ X 線を考えると、ホログラフィックな構造解析も夢 でなくなるような気がしている。

### 謝辞

本研究を進めるにあたり,高エネルギー物理学 研究所放射光実験施設元施設長 高良和武 名誉教 授に数々の御指導をいただいた。また放射光実験 施設の安藤正海教授,松下正教授,東大工学部の 菊田惺志教授には,いくつかの点で議論していた だいた。

この実験の実際上の遂行には、安定で寿命の長 い放射光が不可欠であり、それを作るために、日 夜努力しておられる放射光実験施設の入射器、光 源系スタッフに感謝する。

#### 参考文献

- T. Ishikawa: to be published in Acta Crystallogr., A44 (1988).
- 2) T. Ishikawa: in preparation.
- T. Ishikawa, J. Matsui and T. Kitano: Nucl. Instrum. Methods, A246, 613 (1986).
- K. Kohra and S. Kikuta: Acta Crystallogr., A24, 200 (1968).
- 5) 三宅静雄:X線の回析,朝倉書店,東京, (1969).
- 6) 高良和武: X線結晶学(仁田勇編), 丸善, 東京, p. 850, (1961).
- B.W. Batterman and H. Cole: Rev. Mod. Phys., 36, 681 (1964).
- 8) N. Kato: Acta Crystallogr., 11, 885 (1958).
- 9) P.P. Ewald: Acta Crýstallogr. 11, 888 (1958).
- 10) M. Renninger: Z. Naturforsch., 19a., 783 (1964).

- 11) M. Renninger: Z. ang. Phys., 19, 20 (1965).
- 12) H. Ishida, N. Miyamoto and K. Kohra: J. Appl. Crystallogr., 9, 24 (1976).
- S. Takagi, K. Ishida and A. Ootuka: J. Phys. Soc. Jpn., 45, 1067 (1978).
- H. Ishida, N. Miyamoto, T. Ishikawa and K. Kohra: Z. Naturforsch., 37a, 650 (1982).